

第 7 回反応性プラズマ国際会議
[7th International Conference on Reactive Plasmas]
第 28 回プラズマプロセッシング研究会
[28th Symposium on Processing Plasmas]
第 63 回電離気体会議
[63rd Gaseous Electronics Conference]

共 催：アメリカ物理学会、応用物理学会

協 賛：原子衝突研究協会 他

会 期：2010 年 10 月 4 日(月) ~ 8 日(金)

会 場：Maison de la Chimie

28, Rue St Dominiques, 75007 Paris, France

URL: <http://www.maisondelachimie.com/>

開催目的

反応性プラズマを利用したプラズマプロセスは、薄膜電子デバイスの製造、半導体集積回路の超微細加工、ナノテクノロジーやバイオテクノロジー等に関わる新素材の創製、環境科学等における基盤技術として発展しています。

本国際会議は、プラズマプロセスに関連する諸現象を物理・化学的観点から基礎的に解明し、複雑な反応性プラズマを制御する手法を学術的に確立することを主眼とすると共に、これを基にした最先端のプラズマ応用について、全世界の第一線の研究者による講演、研究発表、討議を行います。これによりこの分野の一層の発展を期するとともに、プラズマプロセスに係わる研究者の国際的な連携を強めます。

プログラム、参加登録などの詳細は以下の URL をご覧ください

URL: <http://www.plasma.engg.nagoya-u.ac.jp/icrp-7/>

URL: <http://gec-icrp2010.polytechnique.fr/>

実行委員会事務局：第 7 回反応性プラズマ国際会議 事務局

豊田浩孝

名古屋大学 工学研究科 電子情報システム専攻

プラズマナノ工学研究センター

〒464-8603 愛知県名古屋市千種区不老町 C3-1(631)

TEL: 052-789-4698 / FAX: 052-789-3150

e-mail: icrp7@plasma.engg.nagoya-u.ac.jp